### Процессы релаксации упругой энергии в гетероструктурах с напряженными нановключениями

© А.Л. Колесникова, А.Е. Романов\*, В.В. Чалдышев\*

Институт проблем машиноведения Российской академии наук, 199178 Санкт-Петербург, Россия

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: aer@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 28 июня 2006 г.)

Исследуется релаксация упругой энергии в системах, содержащих нановключения. Релаксация связана с образованием дислокационных петель: одиночной дислокационной петли несоответствия или группы таких петель на границе нановключения и окружающей матрицы и (или) дислокационной петли-сателлита вблизи включения. Определяются критические размеры включений, начиная с которых возможно зарождение дислокационных петель несоответствия и петель-сателлитов, для различных моделей релаксационных процессов. Приводятся расчетные и экспериментальные зависимости диаметра дислокационной петли-сателлита от размера включения.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 05-08-65503-а).

PACS: 68.65.Hb, 81.07.Ta

Хорошо известно, что в гетеросистемах "пленка—подложка" упругая деформация возникает из-за несоответствия параметров кристаллических решеток тонкой пленки и массивной подложки. Упругая энергия такой гетероструктуры линейно зависит от толщины пленки. При достижении критического значения толщины происходит сброс упругой энергии за счет образования дислокаций несоответствия (МD) на интерфейсе [1–4]. Эти дислокации, расположенные в плоскости границы раздела пленки и подложки, и в особенности дислокации, проникающие с поверхности в пленку, приводят к нарушению электронных и оптоэлектронных свойств гетероструктуры в целом [5,6].

Аналогично пленочным гетерослоям упругая деформация структур, содержащих квантовые точки, обусловлена несоответствием параметров кристаллических решеток квантовой точки и окружающей матрицы (для случая объемных квантовых точек) или несоответствием параметров решеток квантовой точки и подложки (для случая поверхностных квантовых точек). Различие параметров решеток позволяет моделировать квантовые точки нановключениями и островками с заданной собственной деформацией (eigenstrain)  $\varepsilon^*$ . Примеры такого моделирования объемных и поверхностных квантовых точек с различными видами собственной пластической деформации даны в работах [7–9] и [10,11] соответственно. Упругие искажения, вносимые нановключениями (квантовыми точками) в систему, рассчитываются по заданной собственной деформации [12]. Энергия упругих искажений включений пропорциональна их объему и гипотетически может достигать неограниченно больших значений. Существуют каналы релаксации упругой энергии системы с включениями, связанные с образованием дополнительных дефектов — дислокаций. Как и в случае пленочных гетероструктур, дислокации в структурах с включениями нежелательны, поскольку искажают электронные и оптоэлектронные свойства материалов (см., например [13]). Поэтому исследования процессов релаксации упругой энергии в гетероструктурах с квантовыми точками, моделируемыми нановключениями, носят и фундаментальный, и прикладной характер.

Для систем с нановключениями рассчитаны релаксационные пути, сопровождающиеся испусканием соосных дислокационных петель [14] и петель-сателлитов [15] или образованием дислокационных петель несоответствия [16].

В настоящей работе подробно анализируется случай одновременного зарождения одиночной дислокационной петли несоответствия на границе нановключения и окружающей его матрицы и сопутствующей дислокационной петли-сателлита. Для сравнения представлены ранее рассмотренные авторами случаи образования дислокационной петли-сателлита при изменении собственной деформации включения  $\varepsilon^*$  [15] и зарождения на границе включения дислокационной петли несоответствия без выброса петли-сателлита [16,17].

Образование дислокационных дефектов во всех представленных в данной работе вариантах релаксации связано с диффузией атомов включения или матрицы. Отметим, что изменение формы и ориентации включения для случая разновеликости компонент собственной деформации [7,9,18,19] тоже можно считать диффузионными путями минимизации упругой энергии системы.

# 1. Общие схемы релаксации упругой энергии гетеросистем с нановключениями, сопровождающейся образованием дислокационных петель

Результатом исследуемых процессов релаксации упругой энергии нановключением является появление одной или более дислокационных петель. На рис. 1 схематично представлены возможные варианты образования дислокационных петель в системе с нановключениями.

Нановключение (NI) в форме сфероида окружено матрицей и до релаксации не имеет дислокаций ни на своей поверхности, ни вблизи себя (рис. 1, a). С ростом NI его упругая энергия достигает некоторого критического значения, при котором становится выгодным образование дислокационных петель. Для определенности считаем, что параметры решетки материала сфероида  $a_{\rm NI}$  больше параметров решетки матрицы  $a_{\rm mat}$ :  $a_{\rm NI} > a_{\rm mat}$ . Сброс упругой энергии может осуществляться за счет диффузии атомов матрицы, прилегающих к включению (рис. 1, b, d, f) [20]. Диффундирующие атомы образуют сопутствующую дислокационную петлю внедрения (рис. 1, b, d) или уходят (например, на свободную поверхность рис. 1, f). При этом на сфероиде может появиться дислокационная петля вычитания (рис. 1, b, f), либо уменьшается параметр несоответствия, а следовательно, и собственная деформация включения  $\varepsilon_m^{\mathrm{final}} < \varepsilon_m^{\mathrm{initial}}$  (рис. 1, d). Дислокационная петля на границе NI является дислокационной петлей несоответствия и аналогична дислокации несоответствия, образующейся в тонкой напряженной пленке, находящейся на массивной подложке. Чтобы не ограничивать общность рассмотрения, на фрагментах c, e, g рис. 1 показаны аналогичные дислокационные петли, но образованные продиффундировавшими атомами из сфероида в окружающий кристалл. Петель несоответствия может быть несколько и опоясывать включение они могут в разных направлениях (рис. 1, h).

Петли-сателлиты обнаружены экспериментально вблизи нанокластеров, образовавшихся в  $\delta$ -допированном сурьмой арсениде галлия [15], и ранее в твердом растворе фосфора в германии [21].

Дислокации несоответствия неоднократно наблюдались в системах с островками (см., например, работы [22,23]). Дислокацию несоответствия на включении, внедренном в матрицу, трудно идентифицировать. Это связано с отсутствием эталонных расчетных электронно-микроскопических изображений дислокаций на включении, а при атомном разрешении проблематично обнаружить недостающий (или добавочный) атомный слой, связанный с дислокацией.

Далее приводятся расчеты трех возможных случаев расположения дислокационной петли в системе с нановключением: вне и на его поверхности, одновременно и по отдельности.

#### 2. Упругие поля и энергии включений

В наших модельных расчетах включение внедрено в кристалл (рис. 1,a). Несоответствие параметра кристаллической решетки этого дефекта  $a_{\rm NI}$  и параметра решетки окружающей матрицы  $a_{\rm mat}$  имеет смысл собственной деформации [16,17] и определяется как

$$\varepsilon_m = \frac{a_{\rm NI} - a_{\rm mat}}{a_{\rm NI}}.\tag{1}$$

Заметим, что знак  $\varepsilon_m$  в выражении (1) противоположен знаку параметра несоответствия, который обычно используется при описании гетероэпитаксиальной тонкой пленки на толстой подложке (см., например, [2]).

Для включения NI, окруженного со всех сторон матрицей, собственная деформация  $\varepsilon_{ij}^*$  в общем виде может быть записана в следующей форме:

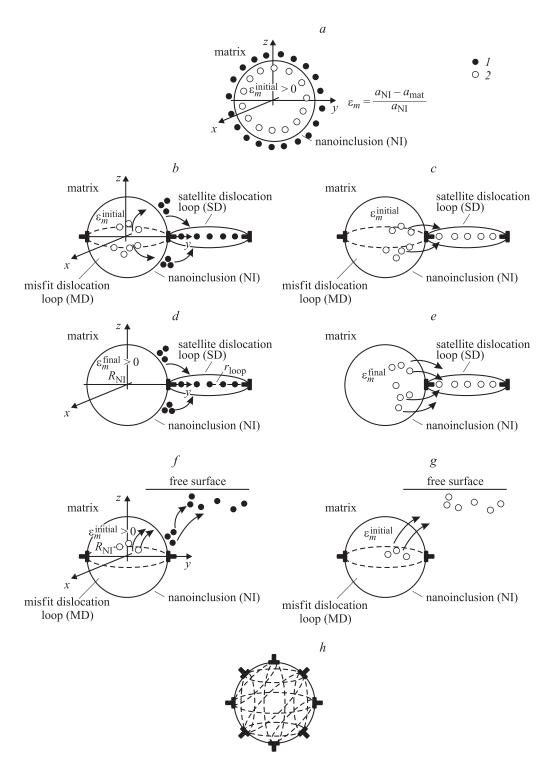
$$\boldsymbol{\varepsilon}^* = \begin{pmatrix} \varepsilon_{mxx} & \varepsilon_{mxy} & \varepsilon_{mxz} \\ \varepsilon_{mxy} & \varepsilon_{myy} & \varepsilon_{myz} \\ \varepsilon_{mzx} & \varepsilon_{mzy} & \varepsilon_{mzz} \end{pmatrix} \delta(\Omega_{\text{NI}}), \tag{2}$$

где диагональные члены соответствуют дилатационному несоответствию кристаллических решеток включения NI и окружающей матрицы, а остальные члены имеют значение сдвигового несоответствия кристаллических решеток;

$$\delta(\Omega_{\rm NI}) = \begin{cases} 1, \ r \in \Omega_{\rm NI} \\ 0, \ r \notin \Omega_{\rm NI} \end{cases}, \ \Omega_{\rm NI} \ \mbox{— область, занимаемая NI}.$$

Упругие поля включения (напряжения  $\sigma_{ij}$  и деформация  $\varepsilon_{ij}$ ) и поле полных смещений  $u_j$  вычисляются по данной собственной деформации (2) и, следовательно, зависят от несоответствия  $\varepsilon_{mkl}$  и области локализации включения  $\Omega_{\rm NI}$ . Расчет упругих полей включения проводится по известной схеме с использованием упругих модулей, функции Грина упругой среды или ее Фурье-образа [12]. Для объемных дефектов сфероидальной или эллипсоидальной формы упругие поля представляются аналитически. Например, ненулевые компоненты напряжений сфероида с несоответствием по трем координатным осям  $\varepsilon_{xx}^* = \varepsilon_{mxx}$ ,  $\varepsilon_{yy}^* = \varepsilon_{myy}$ ,  $\varepsilon_{zz}^* = \varepsilon_{mzz}$  ( $\varepsilon_{ij}^* = 0$ ,  $i \neq j$ ) в изотропном случае имеют вид [8,12]

$$\begin{split} \sigma_{xx}^{(in)} &= -\frac{2G}{15(1-\nu)} \Big[ 8\varepsilon_{mxx} + \varepsilon_{myy}(5\nu+1) + \varepsilon_{mzz}(5\nu+1) \Big], \\ \sigma_{ij}^{(in)} &= 0, \qquad (i \neq j), \end{split}$$



**Рис. 1.** Механизмы релаксации упругой энергии нановключениями за счет диффузии атомов и образования дислокационных петель. a — нановключение (NI) в матрице до процесса релаксации. I — атомы матрицы, 2 — атомы включения; b — диффузия атомов из прилегающей к нановключению (NI) матрицы и образование петлевой дислокации несоответствия (MD) и сопутствующей дислокационной петли-сателлита (SD),  $\varepsilon_m$  — параметр несоответствия; c — диффузия атомов из нановключения и образование петлевой дислокации несоответствия и сопутствующей дислокационной петли-сателлита; d — диффузия атомов из прилегающей к нановключению (NI) матрицы и образование дислокационной петли-сателлита (SD),  $\varepsilon_m^{\text{initial}}$  — параметр несоответствия до и после образования сопутствующей дислокационной петли; e — диффузия атомов из нановключению (NI) матрицы на свободную поверхность и образование петлевой дислокации несоответствия (MD),  $\varepsilon_m$  — параметр несоответствия; g — диффузия атомов из нановключения на свободную поверхнось и образование петлевой дислокации несоответствия; h — образование семейств петлевых дислокаций несоответствия на включении. Стрелками на частях b-g указаны направления диффузионных потоков.

$$\sigma_{xx}^{(out)} = \frac{G}{15(1-\nu)\tilde{R}^9} \Big[ \varepsilon_{mxx} (24\tilde{x}^4 - 40\tilde{x}^6 - 72\tilde{x}^2\tilde{y}^2 + 9\tilde{y}^4 + 45\tilde{x}^2\tilde{y}^4 + 5\tilde{y}^6 - 72\tilde{x}^2\tilde{z}^2 + 18\tilde{y}^2\tilde{z}^2 + 90\tilde{x}^2\tilde{y}^2\tilde{z}^2 + 15\tilde{y}^4\tilde{z}^2 + 9\tilde{z}^4 + 45\tilde{x}^2\tilde{z}^4 + 15\tilde{y}^2\tilde{z}^4 + 5\tilde{z}^6 \Big) \\ + \varepsilon_{myy} (-12\tilde{x}^4 + 10\tilde{x}^6 + 81\tilde{x}^2\tilde{y}^2 - 45\tilde{x}^4\tilde{y}^2 - 12\tilde{y}^4 - 45\tilde{x}^2\tilde{y}^4 + 10\tilde{y}^6 - 9\tilde{x}^2\tilde{z}^2 + 15\tilde{x}^4\tilde{z}^2 - 9\tilde{y}^2\tilde{z}^2 + 45\tilde{x}^2\tilde{y}^2\tilde{z}^2 + 15\tilde{y}^4\tilde{z}^2 + 3\tilde{z}^4 - 5\tilde{z}^6 - 10\nu\tilde{x}^6 - 30\nu\tilde{x}^4\tilde{y}^2 - 30\nu\tilde{x}^2\tilde{y}^4 - 10\nu\tilde{y}^6 + 30\nu\tilde{x}^2\tilde{z}^4 + 30\nu\tilde{y}^2\tilde{z}^4 + 20\nu\tilde{z}^6 \Big) + \varepsilon_{mzz} (-12\tilde{x}^4 + 10\tilde{x}^6 + 81\tilde{x}^2\tilde{z}^2 - 45\tilde{x}^4\tilde{z}^2 - 12\tilde{z}^4 - 45\tilde{x}^4\tilde{z}^2 + 10\tilde{z}^6 - 9\tilde{x}^2\tilde{y}^2 + 15\tilde{x}^4\tilde{y}^2 - 9\tilde{y}^2\tilde{z}^2 - 45\tilde{x}^2\tilde{y}^2\tilde{z}^2 + 15\tilde{z}^4\tilde{y}^2 + 3\tilde{y}^4 - 5\tilde{y}^6 - 10\nu\tilde{x}^6 - 30\nu\tilde{x}^4\tilde{z}^2 - 30\nu\tilde{x}^2\tilde{z}^4 + 10\tilde{z}^6 + 30\nu\tilde{x}^2\tilde{y}^4 + 30\nu\tilde{z}^2\tilde{y}^4 + 20\nu\tilde{y}^6 \Big],$$

$$\sigma_{xy}^{(out)} = \frac{G\tilde{x}\tilde{y}}{(1-\nu)\tilde{R}^9} \Big[ \varepsilon_{mxx} (4\tilde{x}^2 - 4\tilde{x}^4 - 3\tilde{y}^2 - 3\tilde{x}\tilde{y}^2 + \tilde{y}^4 - 3\tilde{z}^2 - 3\tilde{x}^2\tilde{z}^2 + 2\tilde{y}^2\tilde{z}^2 + \tilde{z}^4 \Big) + \varepsilon_{myy} (4\tilde{y}^2 - 4\tilde{y}^4 - 3\tilde{x}^2 - 3\tilde{x}^2\tilde{y}^2 + \tilde{z}^4 + 10\tilde{z}^4 + 10\tilde{z}^4$$

Здесь напряжения даны в декартовой системе координат (x,y,z), связанной с центром сфероида (рис. 1,a). Компоненты напряжений  $\sigma_{yy}^{(in),(out)}$  и  $\sigma_{zz}^{(in),(out)}$  определяются циклической перестановкой индексов и координат (x,y,z) в выражениях для  $\sigma_{xx}^{(in),(out)}$ ; компоненты  $\sigma_{zx}^{(out)}$ ,  $\sigma_{yz}^{(out)}$  находятся перестановкой индексов и координат (x,y,z) в выражении для  $\sigma_{xy}^{(out)}$ . Верхний индекс (in), (out) обозначает внутреннюю или внешнюю область сфероида соответственно; v — коэффициент Пуассона, G — модуль сдвига,  $\tilde{R} = R/R_{\rm NI}$ ,  $\tilde{x} = x/R_{\rm NI}$ ,  $\tilde{y} = y/R_{\rm NI}$ ,  $\tilde{z} = z/R_{\rm NI}$ ,  $R^2 = r^2 + z^2$ ,  $R^2 = r^2 + r^2$ ,  $R^2 = r^2$ 

Упругая энергия включения с известной собственной деформацией (2) может быть записана следующим образом [12]:

$$E_{\rm NI} = -\frac{1}{2} \int \varepsilon_{ij}^* \sigma_{ij}^{(in)} dV, \tag{4}$$

где  $\sigma_{ij}^{(in)}$  — компоненты тензора напряжений внутри включения.

В случае когда параметры несоответствия равны по трем осям  $\varepsilon_{xx}^* = \varepsilon_{yy}^* = \varepsilon_{zz}^* = \varepsilon_m$  и сдвиговые компоненты собственной деформации отсутствуют, упругая энергия сфероидального дефекта представляется формулой  $E_{\rm NI} = \frac{8\pi(1+\nu)}{3(1-\nu)}\,G\varepsilon_m^2R_{\rm NI}^3$ . Для напряженного сфероида с одноосной однородной собственной деформацией  $(\varepsilon_{zz}^* = \varepsilon_m,\ \varepsilon_{xx}^* = \varepsilon_{yy}^* = 0) - E_{\rm NI} = \frac{32\pi}{45(1-\nu)}\,G\varepsilon_m^2R_{\rm NI}^3$  [12]. Видно, что с ростом радиуса включения его упругая энергия растет по кубическому закону.

Начиная с некоторого критического значения радиуса  $R_C$ , "запускается" механизм сброса упругой энергии квантовой точки. Энергетическим критерием такого "запуска" является

$$E^{\text{initial}} > E^{\text{final}}.$$
 (5)

здесь  $E^{\text{initial}}$ ,  $E^{\text{final}}$  — упругая энергия системы с нановключением до и после релаксации.

## 3. Парное образование призматической дислокационной петли несоответствия на включении и петли-сателлита вблизи него (рис. 1, b, c)

Рассмотрим квантовую точку сферической формы с равноосной собственной деформацией:  $\varepsilon_{ii}^* = \varepsilon_m$ ,  $\varepsilon_{ij}^* = 0$  ( $i \neq j, i, j = x, y, z$ ). Поле напряжений (3) включения, моделирующего такую квантовую точку, значительно упрощается. Например, внутри включения

$$\sigma_{xx}^{(in)} = \sigma_{yy}^{(in)} = \sigma_{zz}^{(in)} = -\frac{4(1+\nu)G\varepsilon_m}{3(1-\nu)}.$$
 (6)

При достижении энергией включения NI  $E_{\rm NI}$  некоторой критической величины система "NI—матрица" преобразуется в систему "NI—дислокационная петля несоответствия MD—петля-сателлит SD—матрица". Энергетическое условие (5) такого пути релаксации примет вид

$$E_{\rm NI} \ge E_{\rm NI} + E_{\rm MD} + E_{\rm SD} + E_{\rm NI-MD} + E_{\rm NI-SD} + E_{\rm MD-SD}.$$
 (7)

Здесь  $E_{
m MD}$ ,  $E_{
m SD}$  — энергии дислокационной петли несоответствия и петли-сателлита;  $E_{
m NI-MD}$ ,  $E_{
m NI-SD}$  — энергии взаимодействия включения с дислокационными петлями;  $E_{
m MD-SD}$  — энергия взаимодействия петель.

Дополнительное условие, учитывающее постоянство вещества в рассматриваемой системе (так называемый закон сохранения масс) и связывающее радиусы образовавшихся петель, представляют собой следующее равенство:

$$b_{\rm MD}S_{\rm MD} = b_{\rm SD}S_{\rm SD},\tag{8}$$

где  $b_{\mathrm{MD}},\ b_{\mathrm{SD}}$  — величины векторов Бюргерса петель;  $S_{\mathrm{MD}},\ S_{\mathrm{SD}}$  — площади, занимаемые MD- и SD-петлей соответственно;  $S_{\mathrm{MD}}=\pi r_{\mathrm{MD}}^2,\ S_{\mathrm{SD}}=\pi r_{\mathrm{SD}}^2$ . В частности, из условия (8) видно, что радиус петли-сателлита прямо пропорционален радиусу петли несоответствия;  $r_{\mathrm{SD}}=\beta r_{\mathrm{MD}},\ \beta=\sqrt{\frac{b_{\mathrm{MD}}}{b_{\mathrm{SD}}}}$ .

Для представления неравенства (7) в развернутом виде воспользуемся выражением для энергии взаимодействия двух дефектов (в нашем случае включения и петли) [12]

$$E_{\rm I-II} = -\int_{\Omega_{\rm I}} \varepsilon_{ij}^{*\rm I} \sigma_{ij}^{\rm II} dV = -\int_{\Omega_{\rm II}} \varepsilon_{ij}^{*\rm II} \sigma_{ij}^{\rm I} dV, \tag{9}$$

где  $\Omega_{\rm I},~\Omega_{\rm II}$  — области, занимаемые дефектами I и II соответственно;  $\varepsilon_{ij}^{*{\rm I}},~\varepsilon_{ij}^{*{\rm II}}$  — собственные деформации дефектов;  $\sigma_{ij}^{\rm I},~\sigma_{ij}^{\rm II}$  — упругие напряжения, создаваемые дефектами.

После подстановок соотношение (7) примет вид

$$\begin{split} &\frac{Gb_{\text{MD}}^{2}r_{\text{MD}}}{2(1-\nu)}\left(\ln\frac{1.08\alpha r_{\text{MD}}}{b_{\text{MD}}}\right) \\ &+\frac{Gb_{\text{SD}}^{2}r_{\text{SD}}}{2(1-\nu)}\left(\ln\frac{1.08\alpha r_{\text{SD}}}{b_{\text{SD}}}\right) - \frac{4\pi(1+\nu)Gb_{\text{MD}}\varepsilon_{m}R_{\text{NI}}^{2}}{3(1-\nu)} \\ &-\int\limits_{S_{\text{SD}}}b_{\text{SD}}\sigma_{zz}^{(out)}\Big|_{S=S_{\text{SD}}}dS - \int\limits_{S_{\text{SD}}}b_{\text{SD}}\sigma_{zz}^{\text{MD}}\Big|_{S=S_{\text{SD}}}dS \leq 0, \quad (10) \end{split}$$

где первые два слагаемых — энергии дислокационной петли несоответствия и петли-сателлита соответственно в приближении  $r_{\text{MD,SD}}\gg b_{\text{MD,SD}}$  [24]; третий член — энергия взаимодействия включения NI и дислокационной петли несоответствия; интегральные слагаемые — энергии взаимодействия петли-сателлита с NI и дислокационной петлей несоответствия. Интегралы записаны с условием геометрии рис. 1, интегрирование ведется по площади петли-сателлита,  $\sigma_{ij}^{\text{MD}}$  — тензор напряжений дислокационной петли несоответствия. Параметр  $\alpha$  учитывает энергетический вклад ядра дислокации и может принимать значения 1-4 [25].

Поле напряжений призматической круговой петли "loop" (в частности, MD- или SD-петли) с собственной деформацией  $\varepsilon_{zz}^*=\pm bH \big(1-\frac{r}{r_{\mathrm{loop}}}\big)\delta(z)$  имеет вид [24]

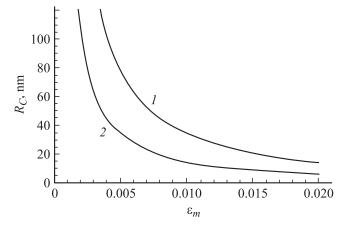
$$\sigma_{rr}^{\text{loop}} = \pm \frac{Gb}{2(1-\nu)} \left[ \frac{1-2\nu}{r} J(1,1;0) + \frac{|z|}{r_{\text{loop}}^{2}} J(1,0;2) - \frac{1}{r_{\text{loop}}} J(1,0;1) - \frac{|z|}{r_{\text{loop}}} J(1,1;1) \right],$$

$$\sigma_{\varphi\varphi}^{\text{loop}} = \pm \frac{Gb}{2(1-\nu)} \left[ \frac{2\nu-1}{r} J(1,1;0) - \frac{2\nu}{r_{\text{loop}}} J(1,0;1) + \frac{|z|}{r_{\text{loop}}} J(1,1;1) \right],$$

$$\sigma_{zz}^{\text{loop}} = \mp \frac{Gb}{2(1-\nu)} \left[ \frac{1}{r_{\text{loop}}} J(1,0;1) + \frac{|z|}{r_{\text{loop}}^{2}} J(1,0;2) \right],$$

$$\sigma_{rz} = \mp \frac{Gb}{2(1-\nu)} \frac{z}{r_{\text{loop}}^{2}} J(1,1;2),$$

$$\sigma_{z\varphi} = \sigma_{r\varphi} = 0. \tag{11}$$



**Рис. 2.** Зависимости критического радиуса сферического включения  $R_C$  от величины параметра несоответствия  $\varepsilon_m$  при различных путях релаксации напряжений. I — релаксации сопровождается образованием петлевой дислокации несоответствия на включении и дислокационной петли-сателлита вблизи него; 2 — релаксация сопровождается образованием одиночной петлевой дислокации несоответствия на включении. Графики построены при следующих параметрах: коэффициент Пуассона  $\nu=0.3$ , константа вклада ядра дислокации  $\alpha=4$ , величина вектора Бюргерса дислокации b=0.3 nm.

В формулах (11) использована система координат, связанная с центром петли и с осью OZ, перпендикулярной плоскости петли; b — величина вектора Бюргерса петли;  $H\left(1-\frac{r}{r_{\text{loop}}}\right)$  — функция Хевисайда;  $\delta(z)$  — дельта-функция;  $r_{\text{loop}}$  — радиус петли;  $\nu$  — коэффициент Пуассона; G — модуль сдвига. J(m,n;p) — интегралы Лифшица—Ханкеля [26], задаваемые соотношением  $J(m,n;p)=\int\limits_0^\infty J_m(\kappa)J_n\left(\kappa\frac{r}{r_{\text{loop}}}\right)\exp\left(-\kappa\frac{|z|}{r_{\text{loop}}}\right)\kappa^p d\kappa; J_m(\kappa)$  — функция Бесселя.

Отметим, что условие (10) применимо и для расчета релаксации с испусканием соосной включению петли-сателлита [14]. При этом в четвертом слагаемом (10) плоскость петли-сателлита может захватывать внутреннюю область включения, и тогда часть интегирования ведется с напряжениями  $\sigma_{ij}^{(in)}$ .

Для оценки полагаем, что дислокационная петля несоответствия имеет экваториальное расположение на сфероидальном включении  $r_{\rm MD}=R_{\rm NI}$ , величины векторов Бюргерса дислокационных петель приблизительно равны  $b_{\rm MD}=b_{\rm SD}=b$ , а интегральные слагаемые малы по сравнению с аналитическими членами. В этом случае критический радиус квантовой точки  $R_C$ , при котором возможна релаксация упругой энергии с парным образованием петли несоответствия и петли-сателлита, определяется из соотношения

$$R_C \approx \frac{3b}{4\pi(1+\nu)\varepsilon_m} \left( \ln \frac{1.08\alpha R_C}{b} \right).$$
 (12)

Подчеркнем, что выражение (12) приближенное и может быть использовано только для определения порядка

величины критического радиуса. На рис. 2 приведен график зависимости критического радиуса от значения несоответствия (кривая I), полученный на основе точного расчета критерия (10) с учетом интегральных членов.

## 4. Одиночная призматическая дислокационная петля вблизи включения (рис. 1, d, e)

Рассмотрим включение сферической формы, обладающей одноосной собственной дилатацией. Собственная деформация для него определяется соотношением:  $\varepsilon_{zz}^* = \varepsilon_m$ ,  $\varepsilon_{xx}^* = \varepsilon_{yy}^* = 0$ . Подобные объекты наблюдались в экспериментах с арсенидом галлия (подробно см. [15]).

Условие "запуска" процесса релаксации (5) содержит начальную упругую энергию системы  $E^{\rm initial}$ , которая в данной модели является упругой энергией включения  $E^{\rm initial}_{\rm NI}$ , и конечную энергию системы  $E^{\rm final}$ . Последняя складывается из конечной упругой энергии включения  $E^{\rm final}_{\rm NI}$ , упругой энергии призматической дислокационной петли-сателлита  $E_{\rm SD}$  и энергии взаимодействия включения и петли  $E_{\rm NI-SD}$ . С учетом изложенного условие (5) представляется в виде

$$E_{\text{NI}}^{\text{initial}} \ge E_{\text{NI}}^{\text{final}} + E_{\text{SD}} + E_{\text{NI-SD}}.$$
 (13)

Диффузия атомов из пространства, прилегающего к включению (рис. 1,d), или из самого включения (рис. 1,e) приводит к изменению параметра несоответствия  $\varepsilon_m$  и, следовательно, собственной деформации. Эту ситуацию можно представить себе и как появление распределенных по поверхности нановключения семейства дислокационных петель (рис. 1,h).

Согласно закону сохранения масс имеем

$$\left(\varepsilon_{m}^{\rm initial} - \varepsilon_{m}^{\rm final}\right) V_{\rm NI} = b S_{\rm SD}, \tag{14}$$

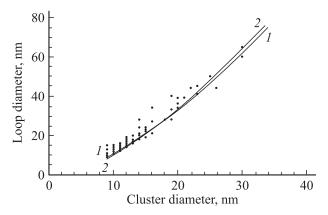
где  $V_{
m NI}=rac{4\pi}{3}\,R_{
m NI}^3,\,S_{
m SD}=\pi r_{
m SD}^2.$ 

Отсюда находим разность параметров несоответствия до и после процесса образования петли-сателлита

$$\Delta \varepsilon_m = \frac{3br_{\rm SD}^2}{4R_{\rm NI}^2}.\tag{15}$$

Минимум упругой энергии системы в конечном состоянии позволяет определить зависимость радиуса образовавшейся петли от радиуса включения при заданном значении параметра несоответствия  $\varepsilon_m^{\text{initial}}$ 

$$\frac{\partial}{\partial r_{\text{SD}}} \left( \frac{32\pi G}{45(1-\nu)} \left( \varepsilon_m^{\text{initial}} - \frac{3br_{\text{SD}}^2}{4R_{\text{NI}}^3} \right)^2 R_{\text{NI}}^3 + \frac{Gb^2 r_{\text{SD}}}{2(1-\nu)} \left( \ln \frac{1.08\alpha r_{\text{SD}}}{b} \right) - \int_{S_{\text{SD}}} b\sigma_{zz}^{(out)} \Big|_{S_{\text{SD}}} dS \right) = 0.$$
(16)



**Рис. 3.** Экспериментальная и теоретическая зависимости диаметра сопутствующей дислокационной петли от диаметра кластера в арсениде галлия,  $\delta$ -допированном сурьмой при низкой температуре. Величины параметра несоответствия и вектора Бюргерса соответственно равны:  $I-\varepsilon_m=0.065,$  b=0.28 nm,  $2-\varepsilon_m=0.035,$  b=0.14 nm. Коэффициент Пуассона  $\nu=0.3$ . Точками представлены экспериментальные данные, полученные для GaAs, выращенного при  $200^{\circ}$ C и отожженного при  $500-600^{\circ}$ C [15].

На рис. 3 показаны экспериментальная и теоретическая зависимости диаметра сопутствующей дислокационной петли от диаметра кластера в арсениде галлия,  $\delta$ -допированном сурьмой при низкой температуре [15]. Величина вектора Бюргерса b дислокационной петли в данных экспериментах была определена с точностью до коэффициента 2. Если предположить, что атомы, образовавшие петлю, диффундировали из области матрицы GaAs, прилегающей к кластеру (рис. 1,d), то  $b=0.28\,\mathrm{nm}$ . Предположение о диффузии атомов сурьмы из кластера (рис. 1,e) приводит к величине вектора Бюргерса  $b=0.14\,\mathrm{nm}$ . На рис. 3 приведены оба возможных расчетных варианта. Значения параметра несоответствия представляли собой разумные гипотетические величины.

## 5. Одиночная призматическая дислокационная петля на поверхности квантовой точки (рис. 1, f, g)

Пусть для системы "нановключение NI—матрица" выполнено условие  $\varepsilon_{ii}^* = \varepsilon_m, \varepsilon_{ij}^* = 0 \ (i \neq j, i, j = x, y, z)$ . Как и в первом из рассмотренных механизмов релаксации, поле напряжений квантовой точки (3) значительно упрощается. Полагаем, что собственная упругая энергия квантовой точки до и после образования дисло-кационной петли несоответствия остается постоянной  $E_{\rm NI}^{\rm initial} = E_{\rm NI}^{\rm final}$ . Тогда критерий зарождения петли несоответствия можно представить условием

$$0 \ge E_{\rm MD} + E_{\rm NI-MD},\tag{17}$$

где обозначения те же, что и в формуле (7).

С учетом экваториального расположения дислокационной петли несоответствия на сфероиде выражение (17) имеет вид

$$\frac{Gb^2R_{\rm NI}}{2(1-\nu)}\left(\ln\frac{1.08\alpha R_{\rm NI}}{b}\right) - \frac{4\pi Gb\varepsilon_{\rm m}(1+\nu)R_{\rm NI}^2}{3(1-\nu)} \leq 0, \ \ (18)$$

где использованы те же обозначения, что и в предыдущих формулах.

Пороговое значение радиуса квантовой точки, при котором на квантовой точке образуется петля, описывается соотношением

$$R_C = \frac{3b}{8\pi(1+\nu)\varepsilon_m} \left( \ln \frac{1.08\alpha R_C}{b} \right). \tag{19}$$

На рис. 2 кривая 2 показывает зависимость  $R_C(\varepsilon_m)$  для рассмотренного выше пути релаксации упругой энергии.

### 6. Обсуждение результатов

Предложенные в работе механизмы релаксации упругой энергии в системах с напряженными нановключениями основаны на энергетическом критерии возможности их реализации. Суть рассматриваемых процессов одна — пластическая деформация с переносом избыточного или недостающего вещества от включения или к нему. Идея об образовании дислокационной петли на границе включения и окружающей его матрицы основана, во-первых, на аналогии этой границы с границей между тонкой пленкой и толстой подложкой, где наблюдаются дислокации несоответствия [1-4] и, во-вторых, на подобии включений и островков, на которых также обнаружены дислокации несоответствия [22,23]. Для островка процесс релаксации подобен протекающему в пленках, т.е. образование дислокации несоответствия (или ансамбля дислокаций) на границе контакта с подложкой. При этом дислокацию можно рассматривать как фрагмент дислокационной петли, линия которой проходит частично по свободной поверхности островка, частично по границе его контакта с подложкой. На основании лишь приведенных расчетов нельзя определить предпочтительный путь релаксации напряжений в гетероструктуре с нановключениями. Рассчитанные критические величины размеров наночастиц (рис. 1, b, c, f, g), при которых энергетически выгоден процесс образования дислокаций, для рассмотренных случаев расположения петель имеют один порядок (рис. 2). Такого же порядка и наблюдаемый в эксперименте критический размер кластера (при аналогичном параметре несоответствия), вблизи которого зарождается петля-сателлит (рис. 3).

"Выбор" пути релаксации гетеросистемой заключается, видимо, в способе ее образования. Разница между нановключениями (квантовыми точками) типа InAs в GaAs или Ge в Si и кластерами As—Sb в GaAs состоит в том, что первые формируются на поверхности или вблизи нее, а кластеры — в объеме. В квантовых

точках избыток вещества, возникающий при пластической деформации, уходит на поверхность. Кинетически это может, например, происходить путем зарождения дислокации на открытой поверхности квантовой точки в процессе ее (точки) формирования с последующим скольжением или переползанием к интерфейсу с матрицей и формированием замкнутой дислокационной петли при заращивании. В случае кластеров As-Sb в GaAs расстояние до поверхности значительно больше длины диффузии при температурах формирования кластеров. В результате вытесняемый растущим кластером материал матрицы формирует дислокационную петлю внедрения вблизи кластера одновременно с формированием петли дислокации несоответствия на самом кластере. Сумма собственных энергий дислокационных колец и энергий их взаимодействия друг с другом и кластером оказывается меньше упругой энергии когерентно-встроенного кластера. Таким образом, в случае кластера As-Sb механизм релаксации упругой энергии реализуется в консервативной системе (материал матрицы, окружавший кластер преобразуется в дислокационную петлю внедрения), а в случае квантовых точек система является открытой за счет того, что поверхность служит бесконечно емким стоком материала. Дислокационные петли вблизи включения наблюдались в экспериментах [14,15,21]. Результаты предложенных расчетов зависимости диаметра дислокационной петли от диаметра включения совпадают с опытными данными. Нелинейный характер зависимости указывает на уменьшение собственной деформации включения в целом (рис. 1, d, e), а не на образование пары дислокационных петель MD-SD (рис. 1, b, c).

Отметим, что испускание дислокационной петли, соосной эллипсоидальному дефекту [14], рассматривается нами, как частный случай расположения петли-сателлита, а не как отдельный механизм релаксации напряжений.

#### Список литературы

- [1] J.W. Mathews, A.E. Blakeslee. J. Cryst. Growth **27**, 118 (1974); **29**, 273 (1975); **32** 265 (1976).
- [2] R. Beanland, D.J. Dunstan, P.J. Goodhew. Adv. Phys. 45, 87 (1996).
- [3] D.J. Dunstan. J. Mater. Sci.: Mater. Electr. 8, 337 (1997).
- [4] A.E. Romanov. Z. Metallkunde **96**, 455 (2005).
- [5] S. Nakamura. Science **281**, 956 (1998).
- [6] H.V. Yu., H. Chen, D. Li, J. Wang, Z.G. Xing, X.H. Zheng, Q. Huang, J.M. Zhou. J. Crystal Growth 266, 455 (2004).
- [7] M. Kato, T. Fujii, S. Onaka. Mat. Sci. Eng. A 211, 95 (1996).
- [8] Н.А. Берт, А.Л. Колесникова, А.Е. Романов, В.В. Чалдышев, ФТТ 44, 2139 (2002).
- [9] N. Usami, T. Ichitsubo, T. Ujihara, T. Takahashi, K. Fujiwara, G. Sazaki, K. Nakajima. J. Appl. Phys. 94, 916 (2003).
- [10] A.D. Andreev, E.P. O'Reilly. Phys. Rev. B 62, 15851 (2000).
- [11] J. Stangl, V. Holsy, G. Bauer. Rev. Modern Phys. 76, 725 (2004).

- [12] T. Mura. Micromechanics of defects in solids. Martinus Nijhoff. Boston (1987). 587 p.
- [13] X. Chen, Y. Lou, A.C. Samia, C. Burda. Nanolett. 3, 799 (2003).
- [14] D.D. Dunand, A. Mortensen. Scripta Met. Mat. 25, 761 (1991).
- [15] V.V. Chaldyshev, A.L. Kolesnikova, N.A. Bert, A.E. Romanov. J. Appl. Phys. 97, 024309 (2005).
- [16] A.L. Kolesnikova, A.E. Romanov. Phil. Mag. Lett. 84, 501 (2004).
- [17] А.Л. Колесникова, А.Е. Романов. Письма в ЖТФ 30, 89 (2004).
- [18] E. Pehlke, N. Moll, A. Kley, M. Scheffler. Appl. Phys. A 65, 525 (1997).
- [19] A.L. Kolesnikova, I.A. Ovid'ko. Phys. Rev. B 69, 035412 (2004).
- [20] Я.Е. Гегузин. Живой кристалл. Наука, М. (1981). 192 с.
- [21] Н.Д. Захаров, В.Н. Рожанский, Р.Л. Корчажкина. ФТТ 16, 1444 (1974).
- [22] F.K. LeGoues, M.C. Reuter, J. Tersoff, M. Hammar, R.M. Tromp. Phys. Rev. Lett. 73, 300 (1994).
- [23] H.J. Chu, J. Wang. J. Appl. Phys. 98, 034315 (2005).
- [24] J. Dundurs, A.J. Salamon. J. Phys. C 50, 125 (1972).
- [25] J.P. Hirth, J. Lothe. Theory of Dislocations. Wiley, N.Y. (1982). 752 p.
- [26] G. Eason, B. Noble, I.N. Sneddon. Phil. Trans. R. Soc. 247, 529 (1955).